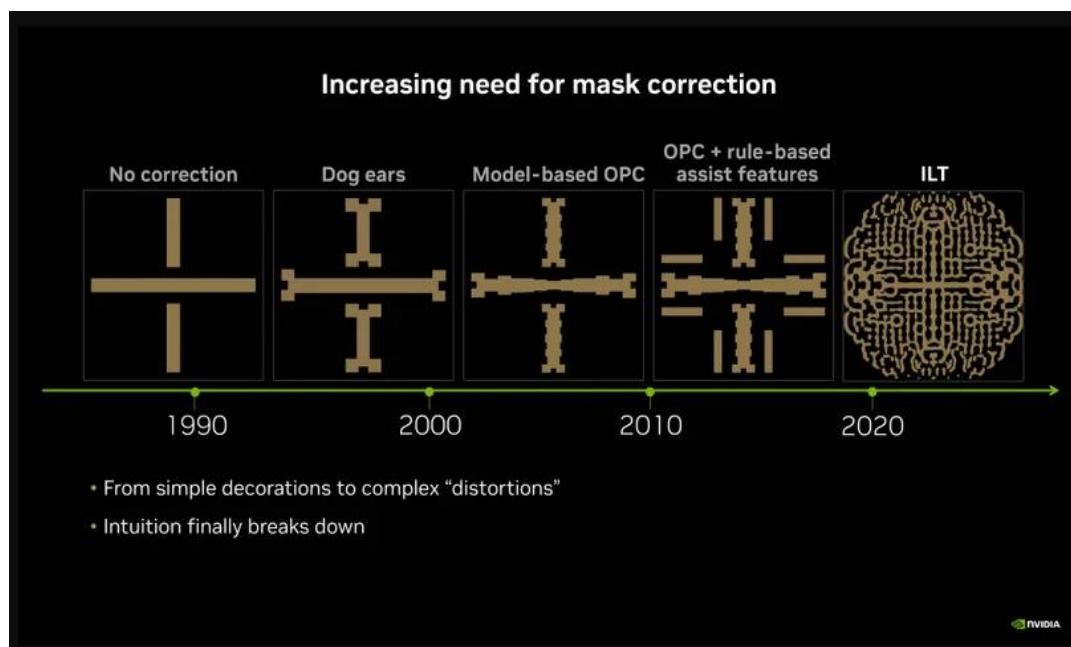
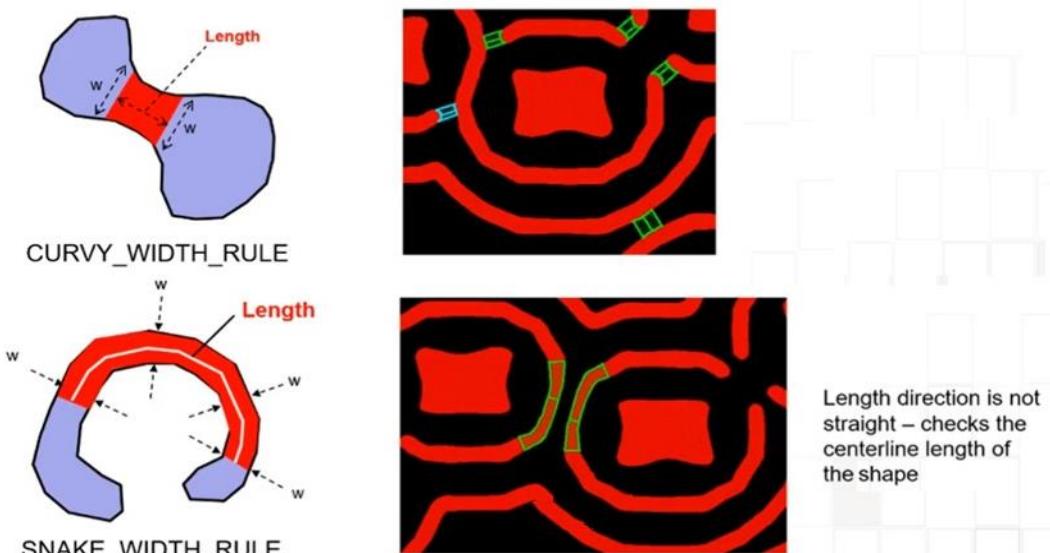


# AI for Semiconductor

## New Curvilinear MRC Addresses Mask Compliance Checking Challenges

TSMC



OPC (光學鄰近校正)是光罩設計中的一種微影增強技術，通過修改光罩圖案來補償光學和製程引起的圖像誤差，確保印刷在矽晶圓上的圖案準確反映原始設計。OPC 透過在光罩上添加或調整特徵，例如襯線 (serifs) 和次解析輔助特徵 (SRAFs)，來抵消光刻過程中出現的變形，例如線寬變化與角落圓化等問題。